



Plasma Processor

プラズマ処理装置

本装置は、減圧容器内のガスの高周波放電プラズマによる、各種材料の表面処理を行うものです。特に高分子材料の処理等に有効です。



【構成】

- ①500W高周波電源 整合器付
 - ②デジタルピラニ真空計
 - ③炉体
 - ④操作パネル
 - ⑤真空ポンプ
- ※①～④は同一筐体に組み込みとなります。

【仕様】

形式	RPT-3000-05	
高周波出力電力	0～500W	
炉体	形状	横置き前面扉方式
	炉体寸法	約φ500mm×500mm
	材質	アルミ製
	覗き窓	有効径φ100mm
	到達真空度	常用 1×10^{-2} torr
ユーティリティー	電力	3相 AC200V 約4.5kVA
	冷却水	3L/min 以上



日本高周波株式会社